

富加津 好 夫 (フカツ ヨシオ)

株式会社ホロン社長



新製品「EBLITHO」を 新事業領域のLED市場に投入

◆競合企業との競争激化等により売上が減少

2007年3月期の概略としては、9月に販売を予定していた「EMU-270」が客先の予算の都合で遅れたため、中間期の業績予想を下方修正した。11月には、新製品の電子スタンプ「EBLITHO」を発表している。この装置は、LED製造向けのステンシルマスクを利用した低加速電子ビーム高速転写装置である。当社は既にステンシルマスクの検査装置を手掛けたことがあり、この製品は、当社が保有する低加速電子ビームをコントロールする技術を利用したものである。当期の収益には貢献しなかったが、3月には受注に成功しており、今後も販売拡大に注力していく。2月には、停滞したままのCD-SEM市場で回復の兆しが見られず、当社の対応も結果を見ることができなかつたため、通期の売上・損益共に大幅な下方修正を発表するに至った。

当期の業績を2月に発表した修正予想と比較すると、売上高は5億50百万円の予想に対して5億66百万円の実績となった。製品事業は2億72百万円と振るわなかつたものの、サービス工事等は前期比で3.4%増加し、2億93百万円となっている。利益については、売上が増加し、販管費も予定を下回つたため、修正予想を若干上回つた。

前期実績との比較では、すべての売上・損益項目で前期を下回つた。売上については、4億7百万円の減少(41.9%減)となっている。これは、CD-SEM市場が65nmノード対応から45nmノード対応へ移行する過渡期の踊り場となり、市場全体が停滞したことに加え、競合企業との競争激化により、主力製品である「EMU」の販売台数が落ち込んだためである。売上総利益についても、製品の販売台数の減少とともに大幅な落ち込みとなった。この結果、営業利益、経常利益についても大幅な減益となり、赤字決算となった。

営業利益は前期が1億52百万円の損失、当期が4億円の損失となり、減益幅は2億48百万円となった。製品販売の売上減少による減収効果(4億7百万円)が大きな要因であり、減収に伴う売上原価の減少や販管費の圧縮でもカバーすることができず、営業損失が拡大した。

◆当期純損失の拡大により純資産が減少

資産の状況としては、流動資産が前期末比で27%減少して15億4百万円となった。販売の不振が影響し、現金および預金が4億33百万円減少したことが主な要因である。固定資産は3.5%増加して3億81百万円となった。この結果、総資産は22.3%減少して18億85百万円となっている。負債・純資産の状況としては、流動負債が36%減少して3億25百万円となった。仕入債務が1億78百万円減少したことが主な要因である。固定負債は15.5%増加して2億40百万円である。この結果、負債合計は21.1%減少して5億66百万円となった。一方、純資産合計は前期末比で22.9%減少し、13億19百万円となっている。主な減少要因は、当期純損失が1億38百万円と大幅に増加したことである。

キャッシュフローの状況としては、現金および現金同等物は前期末比で5億23百万円減少し、6億25百万円となった。営業活動の結果使用した資金は4億52百万円となっており、法人税等の還付で96百万円増加した一方で、税引前当期純損失が3億95百万円発生し、仕入債務が1億75百万円減少した。投資活動の結果使用した資金は79百万円となっており、主に固定資産の取得によるものである。財務活動の結果得られた資金は7百万円となっており、主に新株予約権の行使によるものである。

販管費は前期比で6百万円減少した。減少要因は、人件費の削減と売上高の減少に伴う販売手数料および運搬費等の変動費の減少である。試験研究費については、新製品開発のため19百万円増加した。前期から引き続き「超音波モータの無発塵化と三次元制御型超精密ステージ開発」の研究開発を行っており、当期は経済産業省より28百万円の補助金が交付されている。前期に交付された61百万円と同様、補助金と試験研究費を相殺していることから、実態としては同額だけ余分に試験研究費を使用している。減価償却費の増加については、新製品開発にかかわるノウハウ利用権の償却によるものである。

当期の受注高は6億1百万円となった。前期の9億70百万円と比較して低調に推移し、現在まで回復に至って

いない。受注残高については、前期とほぼ同水準の約1億50百万円となっている。

◆販売体制と営業力の強化を図る

2008年3月期については、マスク用寸法測定装置のマーケットにおいて、引き続き競争が厳しくなると予想しており、通期で黒字を確保したいと考えているが、現段階ではJASDAQ上場当時を上回る売上・利益水準を確保することは難しいとみている。しかし、半導体業界においては、最新のフォトマスク商品である65nmノードから、さらに微細な次世代最先端フォトマスクである45nmノードへの開発・試作が2008年を目指して活発化する兆候が見られている。リソグラフィプロセス機器の大型設備の投資と相まって、寸法測定装置についても設備投資が予想されている。

このような状況の下、主力製品であるマスク用寸法測定装置「EMU-270」については、当期にさらなる性能アップに成功し、高性能・高付加価値化を実現しており、今後の販売計画拡大の準備が整ったと考えている。また、マスク用寸法測定装置だけではなく、新製品のLED生産用パターン転写装置「EBLITHO」を複数台、売上に計上したいと考えている。

今期の最重要課題は、増益基調に戻すため、より高い利益を確保できる体制に変革していくことである。具体的な戦略としては、販売体制と営業力の強化を目指して、主力製品「EMU」の性能アップ、新製品「EBLITHO」の新市場投入、営業体制の強化を進めていく。

「EMU」の性能アップについては、次世代の32nmノード以降にも対応させるために、分解能を大幅に向上させるべく研究開発を継続していく。また、微細化する測定対象パターンを一次元から二次元的に展開して高精度な測定を可能にし、多種複雑なパターンに対応した自動測定手法を顧客に提供し、高性能化・高付加価値化を実現して商品力の向上を図っていく。

「EBLITHO」については、当社保有の技術を利用して低価格、高処理能力を実現しているため、高スループットに対する要求に対応できる新規の方法を考案し、高付加価値を付けた製品化を進めていく。手動タイプの装置については、3月に初の受注に成功しているため、これを拠点に高性能機の販促を進めていきたいと考えている。

営業体制については、営業技術の充実・強化を図るため、技術担当の取締役1名の選任を予定している。これにより、当面の課題であったユーザーの技術ニーズに対する理解不足や当社製品の優位性についての説明不足等を克服し、営業と技術の連携強化を図って、ユーザーの技術的ニーズに対応できる体制を構築したいと考えている。

◆ 質 疑 応 答 ◆

今期の売上高予想は、上期が2億10百万円、下期が14億円となっているが、販売台数を教えてほしい。

上期は「EBLITHO」で2台、下期は「EMU」で3台、「EBLITHO」で3台の売上を予定している。

「EBLITHO」および「EMU」の足元の受注状況を教えてほしい。

3月末時点の受注残は「EBLITHO」1台のみである。「EMU」は45nmノードに対する投資の実行は下期となり、まだ各社で検討に入っている段階であるため、これから市場が動き出す。

「EBLITHO」と競合する製品はあるのか。

競合する製品としては「ナノインプリント」があるが、この製品には、パターン転写時に原盤である金型の汚損等の欠点があり、当社の装置の方が優れていると考えている。

「EMU」の競合の状況を教えてほしい。

3年ほど前までは、当社が市場をほぼ独占していたが、2年ほど前からはライカとアプライド・マテリアルズが進出しており、現在、ライカとの競争になっている。65nmノードでは負けたと考えているが、45nmノードについては新たな競争に入ったところであり、最終的には性能の良いところが勝つと考えている。現在、デバイスメーカーは32nmノードを同時に要求してきているが、32nmノードをにらんだ製品は簡単にはできない。当社では、従来にない高性能の製品を開発しており、そこで勝負していきたいと考えている。

当期は当初計画の15億円に対して実績が5億円となっている。今期についても14億円を計画しているが、当期のようなことは起こらないのか。

当期と今期では、市場規模が異なる。当期は、65nmノードの投資がほぼ終わったため、例年の半分以下の市場規模だったが、今期は45nmノードへの投資が始まるため、市場規模が拡大するとみている。また、「EBLITHO」という新市場もある。

(平成19年5月11日・東京)